

Procedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe bază de crom trivalent, care include depunerea acoperirii de crom dintr-un electrolit oxalat-sulfat, care conține, g/L:  $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  – 200,  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$  – 30,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  – 80, la un pH de 0,8...1,2, temperatura electrolitului de 35...45°C, densitatea curentului catodic de 2,0...4,0 kA/m<sup>2</sup>, cu utilizarea unei surse de curent trifazat și a unui dispozitiv inductiv-capacitiv, conectat consecutiv în circuitul de alimentare a băii galvanice, totodată dispozitivul este format din două blocuri – capacitiv și inductiv, conectate paralel între ele, blocul inductiv având inductanța în limitele 0,1...10,0 H, iar blocul capacitiv având capacitatea sumară în limitele 0,001...0,11 F.